# SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Patent Number:

JP3011757

Publication date:

1991-01-21

Inventor(s):

. SATO MASAAKI; others: 04

Applicant(s):

HITACHI LTD; others: 01

Requested Patent:

**및 JP3011757** 

Application Number: JP19890145340 19890609

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29; H01L21/56; H01L23/31

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To improve a semiconductor device of this design in humidity resistance and reliability by a method wherein a light transmitting member is fixed by bonding to the outside of the photodetective face of a semiconductor element through the intermediary of a transparent resin layer, and a vacancy is formed between the photodetective face and the light transmitting member.

CONSTITUTION:A solid image sensing device 3 is bonded to a lead frame 1 through an epoxy resin 2, and an Au wire 4 is bonded to the element 3. A light transmitting member 6 of boro-silicate glass whose one side is coated with a semi-cured transparent resin layer 5 is mounted on the device 3. The layer 5 is formed of semi-cured silicon resin whose reactive groups stay reactive as much as 40% of those in a fully cured state. The layer 5 is heated at a temperature of 150 deg.C for one hour and pressed to bond the element 3 to the light transmitting member 6. Moreover, the silicon resin fully covers a photodetective face 7 excluding a bonding pad 8. The assembled body concerned is molded with epoxy resin to form a resin molded body 9. A lead frame part is cut off and fabricated to form a solid-state image sensing device.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

11:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

#### ◎ 公開特許公報(A) 平3-11757

®Int. Cl. 5 H 01 L

識別記号

庁内整理番号

**43**公開 平成3年(1991)1月21日

23/29 21/56

J

6412-5F 6412-5F H 01 L 23/30

F×

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

60発明の名称

半導体装置およびその製造方法

②特 願 平1-145340

**20出. 顔 平1(1989)6月9日** 

700発 明 者 佐 藤 正 昭

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

個発

広 伸 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

の出 頭 頭

株式会社日立製作所 日立マイクロコンピユ

東京都小平市上水本町5丁目22番1号

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

ータエンジニアリング

株式会社

四代 理 人

の出

弁理士 小川 勝男

外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

半導体装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 半導体料子設面の受光面の外側に、透明樹脂 層を介して避光部材を接着固定して設けた構造 を有することを特徴とする半導体装置。
- 2 . 請求項1記載の半導体装置において、半導体 』 兼子表面の受光面と透光部材との間に空隙部を 形成したことを特徴とする半進体整置。
- 3. 請求項1または2記載の半導体装置において、 透明樹脂層がシリコーン系樹脂またはエポキシ 系樹脂よりなることを特徴とする半導体製質。
- 4.半導体楽子表面の受光面の外側に、半硬化し た接着用の透明樹脂層を一面に形成した透光部 材を、該通光部材が上記半導体素子の受光間の 外領に位置するように叙取し、上記波光部材を 半導体表子の受労面に押し圧しながら加熱して、 上記半硬化状態の透明樹脂圏を硬化させて、上 記述光節材を半導体業子の受光回に接着固定す

る工程を有することを特徴とする半週体装置の 解治方法。

- 5、 蘭求項4記載の半導体数置の製造方法におい て、半硬化した接着用の透明機蹈層は、シリコ ーン系樹脂もしくはエポキシ系樹脂によつて構 成され、上記透明横順層中には宋反応基 30~80 % 含まれることを特徴とする半導体装置の製造 方法.
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置およびその製造方法に係り 特にBP-ROM(消去、書き込み可能な半導体 記憶幾子)、固定操像業子などのパッケージに窓 を有する半導体装置およびその製造方法に関する。 〔従来の技術〕

從来の選光部材を有する半導体装置の製造方法 は、例えば特牒昭58-207656号公報に提案されて いるように、リードフレームのチップステージ上 に半導体兼子をダイポンニングし、ワイヤポンデ イングをした役、遊光部材を低粘度のシリコーン

機脂などよりなる透明接着剤を用いて加熱硬化させ上記案子上に接着し固定していた。なお、耐湿度サイクル性を向上させるため、接着剤はポンディングパッド部をコートしない構造にしてある。ついで、上配の起立完成体が形成されたリードフレームを機脂モールドした後、リードフレームの切断、成形加工を行い学導体装置を作製していた。
「発明が解決しようとする課題)

本発明の半導体装置の観過方法において、半碳化した接着用の透明樹脂層は、シリコーン系樹脂もしくはエポキン機脂によって構成され、上紀透明橄脂層中には末反応基が30~80 %含まれることが好ましく、さらに末反応基が50~85%含まれていることが、より好ましい。

上記の方法で作製した本発明の半導体装置は、 半導体素子装面の受光面の外側に、シリコーン系 機脂もしくはエポキシ系機脂よりなる透明樹脂型 を介して透光部材を接着固定して設けた構造を有 するものである。

また、本発明の半導体装置において、半導体業 子表面の受光面と透光部材との間に空隙部を形成 させることも可能である。

#### (作用)

接着用の透明樹脂を透光部材に透布し、加熱して半硬化状態にする過程で、透明樹脂層に含まれている低分子の揮発性物質のほとんどが気化するか、または反応により透明樹脂層から除かれる。 また、少量残留した低分子の揮発性物質も半硬化 リ、アルミニウムパッド部へ水分が侵入し腐食が発生するものと考えられる。また、接着に用いる 逸明樹脂は、樹脂中に含まれる異物を除去しクリ ーンにする必要があるため、透明樹脂が高価格に なるという問題もあった。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消 し、耐趣性に優れた構造の半導体装置およびその 製造方法を提供することにある。

さらに本発明の他の目的は、低価格の半導体装 図およびその製造方法を提供することにある。

# 〔韓趙を解決するための手段〕 一

上記本発明の目的を達成するために、半導体業子表面の受光面の外傷に、半硬化した接着用の透明が起題を一面に形成した選光部材を験選光部材が上記半導体業子の受光面の外側に位置するように設置し、上記透光部材を半導体業子の受光面に接着固定するという半導体装置の作製手段を用いるものである。

した部分子のからみあった構造の中に閉じこめられ、透光部材を接着させる加無硬化時においても外部に出てこない。このため、透明樹脂層中の低分子の揮発性物質によりアルミニウムパッド部が汚染さることがなく、モールド樹脂の密着性が良好となり耐湿性が向上する。

なお、接着用の透明側脂としては、シリコーン 機脂、エポキン樹脂等が好識に用いられる。半硬 化状態としては、接着時に低分子揮発成分が気化 せず、透光部材と十分な密着性を保持する状態が 好ましい。また、透明樹脂中の末反応基は30~80 %含むものが好ましく、さらに50~85%含むもの がより好適である。

そして、透明機淵層を半導体兼子の受光面の外側に形成させる方法として、通常スクリーン印刷 等が用いられる。

### 〔実施例〕

以下に、本発明の一実施例を挙げ、図面に基づいて、さらに辞観に説明する。第1回は本発明の 半導体装置の構成の一例を示す断面図である。図

第1頁の続き

. Dint. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 R 6412-5F

H 01 L 21/56 23/31

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 個発 明者 泉 也

勿発 金田 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 明 爱 三

所生産技術研究所內

東京都小平市上水本町5丁目22番1号 日立マイクロコン ⑫発 明 俊 二 池

ピュータエンジニアリング株式会社内

## 特開平3-11757(3)

においてリードブレーム1に、エポキシ樹脂2によって固体機像素子3を接着し、Au(金)線4をポンディングする。その固体撮像者子3上に形成したホウケイ酸系ガラスからなる透光部材6を収置する。透明樹脂層5はシリコーン系樹脂を用いており、完全硬化の状態に対し40%の反応拡が反応している半硬化樹脂である。これを押し圧透光が反応でで1時間加熱して固体機像素子3と透光では、シリコーン系樹脂は大変光面である。なお、シリコーン系樹脂は大変光面である。ボンディングパッド8は被殴しない構造とする。

次に、上記の手順で作製したリードフレーム機 造品を、成形金型に設置して、トランスファモー ルド法により、エポキシ系機関を用いてモールド し、モールド機関8を形成させる。そして、リー ドフレーム部の切断、成形加工を行い固体機像装 置を作製した。

次に、本発明の他の実施例を第3回に示す。上 記の第1回に示す実施例と同様の工程によって問

第1回は本発明の実施例において例示した固体 扱金装配の斯面構造を示す模式図、第2回は第1 図の要部拡大図で半硬化の透明樹脂接着層を設け た透光部材を示し、第3回は本発明の他の実施例 である固体級像装置の射面構造を示す模式図であ

1…リードフレーム 2…エポキシ樹脂

3 … 劉体投像對子 4 … Au(金)線

5 … 週明樹脂層 6 …

6 … 選光部材

7 … 受光面

8…ポンディングパット

9 …モールド樹脂

10…空放部

体級像装置を作製した。本実施例において、透明 機脂層 5 は、調体機像素子 3 の受光面 7 とポンディングパッド 8 との間に形成されており、受光面 7 と透光部材 6 と透明機脂層 5 で阻まれた空隙部 10 が形成されている。

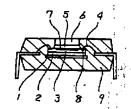
上紀の実施例によって作製した2種の固体機像 接置を、80℃、95%RH影開気中に2000時間放置 したが、いずれも特性劣化はほとんど見られず、 緩れた耐湿性を示した。

### (発明の効果)

以上詳細に説明したごとく、本発明の方法により作製した半導体装置は、加熱硬化して透光部材を接着固定させる半硬化の透明樹脂層からの低分子揮発性物質の発散をほぼ完全に防止することができるので、アルミニウムパッド部などが汚染されることなく、モールド樹脂の密着性が一段と向上するので、種ので制盤性に優れた僧教性の高いレジンモールド固体機像被置やEP-ROM装置などの半導体装置が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図



1… り-ドフレーム 2…エポキシ衛指 3…国体機像乗3 4… Au (全)機 5…透明樹指層 4…逆光都可 7…・変光面 8…ボンディンパッド

9…モールド樹脂

第 2 図

6 逐光部材

5 透明樹脂層

**第** 3 図

5 4

/0--空隙部

代球人弁理士 小 川 勝 男